⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62 - 94841

⑤Int Cl.4

識別記号 353

庁内整理番号

43公開 昭和62年(1987)5月1日

G 03 C 1/72 09 B 11/06 G 03 C 1/727 Z - 8205 - 2H

8217-4H 8205-2H 審査請求 未請求 発明の数 1

(全5頁)

63発明の名称

画像形成組成物

昭60-233545 ②特 願

23出 昭60(1985)10月21日

明 泉 水 ②発 者

秀 行

利

博

夫

東京都北区王子6丁目2番30号 保土谷化学工業株式会社

中央研究所内

田 通 勿発 明 者 権

東京都北区王子6丁目2番30号

保土谷化学工業株式会社

中央研究所内

尾 原 73発 明 者

東京都北区王子6丁目2番30号 保土谷化学工業株式会社

中央研究所内

保土谷化学工業株式会 ①出 願 人 社

東京都港区虎ノ門1丁目4番2号

明 細

1. 発明の名称

画像形成組成物

2. 特許請求の範囲

一般式〔1〕で表わされる酸化発色型のキサン テン化合物を含有することを特徴とする画像形成 組成物。

$$\begin{array}{c|c} Y_{m} & X_{n} \\ \hline R_{1}O & OR_{1} \\ \hline & C & C - R_{2} \end{array}$$

(式中、R1は炭素数1~8のアルキル基、アラ ルキル基を示し、R2は炭素数1~8のアルコキシ 基、低級アルキル基、フェノキシ基、アラアルコ キシ基、又はアミノ基を示し、該アミノ基はアル キル茲、アリール茲、アラルキル基で置換されて いてもよい。X、Y、2はハロゲン原子を示し、

Xn、Ym、ZLは芳香核にX、Y、Zがそれぞれn、 m、 4 個置換しているととを示す。 n および m は 0~2の整数、∠は0~4の整数を示す。) 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は新規なキサンテン化合物を含有する 画像形成組成物に関し、特にフォトレジスト、PS 版、プルーフ材等に用いる色素前駆体として有用 な新規キサンテン化合物を含有する画像形成組成 物に関する。

(従来の技術及び解決すべき問題点)

光照射により発色し画像を形成する組成物は PS版、フォトレジスト等における重ね焼き防止、 フォトマスクの位置確認のため有用であり、また、 簡便なプルーフ材としても用いられる(特開昭55 - 13780号、特開昭59-142545号)。 しか して、これらの組成物としては有機ポリハロゲン 化合物、又は光酸化剤と各種ロイコ染料等の組合 せ (特開昭 5 9 - 140447号、特開昭 5 9 - 142 545号、特開昭 4 7 - 12879 号) 等が代表的な

ものであるが、有機ポリハロゲン化合物は毒性を有し、また光酸化剤とロイコ染料との組合せではロイコ染料としてロイコトリフェニルメタン染料を使用するのであるが、これらは安定性に問題があるばかりでなく、色相の点においても黄色系に発色するものがない等の欠点があった。

(問題点を解決するための手段)

本発明者らは、上記の欠点を改良すべく鋭意 検討した結果、下記の一般式(I)で表わされる新 規なキサンテン化合物は大気中で安定な無色又は 淡色の固体であり、酸化により黄色系に発色しPS 版、フォトレジスト、プルーフ材等に使用できる ことを見出し、本発明を完成するに至った。

すなわち、本発明は一般式(1)

$$\begin{array}{c|c}
Ym & Xn \\
\hline
R_1O & OR_1 \\
\hline
C & R_2 \\
\hline
O & R_2
\end{array}$$

(式中、R1は炭素数1~8のアルキル基、アラル

ロイコ染料をその発色型に酸化する化学種を生ずるものであり、特公昭 4 3 - 19161 号公報記載のヘキサアリールビイミダゾール、米国特許第3282693号公報記載のアジド化合物、米国特許第3,615,568号公報記載のピリジニウム化合物、米国特許第4386,154号公報記載の芳香族沃素塩等をあげることができる。

具体的には、 2. グービス (2 ークロロフェニル) - 4. 5. 4. 5 ーテト ラフェニルー 1. グービイミダゾール、 2. グービス (2 ークロロフェニル) - 4. 5. 4. 5 ーテト ラキス (3 ーメトキシフェニル) - 1. グービイミダゾール、 2. グービス (2 ークロロー4 ーメトキシフェニル) ー 4. 4. 5. 5 ーテトラフェニルー1. グービイミダゾール、 2. グービス (2. 4 ージクロロフェニル) - 4. 5. 4. 5 ーテトラフェニルー1. グービイミダゾール、 2. グービス (2 ーニトロフェニル) - 4. 5. 4. 5 ーテトラフェニルー1. グービイミダゾール、 2. グービス (2 ーニトロフェニル) - 4. 5. 4. 5 ーテトラフェニルー1. グービイミダゾール、 2 ー アジドペンズオキサゾール、 ペンゾイルアジド、 2 ー アジドペンズイミダゾール、 ペンゾイルアジド、 2 ー アジドペンズイミ

キル基を示し、R2は炭素数1~8のアルコキシ基、低級アルキル基、フェノキシ基、アラアルコキシ基、又はアミノ基を示し、該アミノ基はアルキル基、アリール基、アラルキル基で置換されていてもよい。X、Y、Zは大香核にX、Y、Zがそれぞれn、m、L個型換しているととを示す。nおよびmは0~2の整数、Lは0~4の整数を示す。)で設わされる酸化発色型のキサンテン化合物を含有することを特徴とする画像形成組成物である。

本発明における画像形成組成物とはプルーフ材、 PS版、フォトレジスト等における重ね焼き防止又 はフォトマスクの位置確認のために使用する材料 を指す。

本発明の画像形成組成物は、(1)光酸化剤、(2)一般式(1)で示されるキサンテン化合物、(3)発色助剤、(4)バインダーからなり、必要に応じて定着剤を加えることもできる。

光酸化剤は通常不活性であるが、可視光線、紫外線、X線のような活性輻射線に露出されると、

ドチアシアニンパークロレート、1 - メトキシー 2 - メチルピリジニウム- p - トルエンスルホネ - ト、ジフェニルヨードニウムナイトレート、ジ フェニルヨードニウムヘキサフルオロホスフェー ト等が使用できる。

本発明に係る一般式(!)で示されるキサンテン 化合物の具体例としては、3,6 - ジメトキシー 9 - (2-メトキシカルポニル) - フェニルキサン テン、3,6 - ジエトキシー 9 - (2-メトキシカ ルポニル) - フェニルキサンテン、3,6 - ジベン ジルオキシー 9 - (2-エトキシカルポニル) -フェニルキサンテン、3,6 - ジメトキシー 2,7 -ジクロロー 9 - (2-エトキシカルポニル) -フェニルキサンテン、3,6 - ジイソプロポキシー 2,7 -エニルキサンテン、3,6 - ジイソプロポキシー 2,7 - ジクロロー 9 - (2-メトキシカルボニル) - フェニルキサンテン、3,6 - ジメトキシー 9 - (2-メ ルキサンテン、3,6 - ジメトキシー 9 - (2-ジエチルカ

特開昭62-94841(3)

ルポキサミド) -フェニルキサンテン、3.6 -ジ エトキシー 2.7 - ジプロモー 9 - (2 - メトキシ カルポニル) - フェニルキサンテン、 3,6 - ジブ トキシー 9 - (2 - メトキシカルポニル) - フェ ニルキサンテン、 3.6 - ジプロポキシ- 9 - (2 - メトキシカルポニル) - フェニルキサンテン、3, 6-ジメトキシ-9-(2-アセチルフェニル) - キサンテン、3,6 - ジメトキシー9 - (2 - ジ フェニルカルポキサミド)-フェニルキサンテン、 3.6 - ジメトキシー 9 - (2 - エチルフェニルカ ルポキサミド) - フェニルキサンテン、 3,6 - ジ メトキシ-9-{2-N-メチル-N-(p-ト リル) -カルボキサミド } - フェニルキサンテン、 3,6 - ジメトキシー 9 - (2 - N,N - ジベンジル カルボキサミド) -フェニルキサンテン、3,6-ジメトキシー9-(2-フェノキシカルボニル) - フェニルキサンテン等を挙げることができる。 またこれらの塩酸、硫酸、硝酸などの無機酸な よびしゅう酸、p-トルエンスルホン酸、ペンゼ

- 140447号公報記載の鉱酸類又は芳香族スルホン酸類及びポリエーテル類が使用できる。具体的には塩類、臭化水素酸、硫酸、硝酸、リン酸、pートルエンスルホン酸、ペンゼンスルホン酸、pークロロペンゼンスルホン酸、1-ナフタレンスルホン酸、2-ナフタレンスルホン酸、ドデシルペンゼンスルホン酸を挙げることができる。

としてあげられる。発色助剤としては特開昭59

バインダーとして好適に使用できる樹脂は、たとなば、ポリスチレン、ポリピニルブチラール、ポリカーボネート、ポリ塩化ピニル一酢酸ピニル共重合体、スチレンーブタジエン共重合体、シャンーブタジエン共重合体、フォンン・サルセルロース等が挙げられる。又っました。 フスト等に用いる場合には光硬化成分を含ませるととができる。具体的には、ヒドロキシエテルメタリレート、ジエチレングリコールジアクリレート、N·N'ーメチレントリアクリレート、ペンタエリスリトールトリアクリレートをどを挙げると

とができる。

定着を必要とする場合は、定着剤を加えることができ、特公昭43-19161号公報、特開昭59-140447号公報記載のレドックスカップル、グアニジン誘導体、アルキレンジアミン類が使用でき、具体的にはポリエチレングリコールと1,6-ピレンキノンとの組合せ、1,3-ジフェニルグアニジン、トリフェニルグアニジン、ヘキサメチレンジアミン等が使用できる。

ンスルホン酸などの有機酸の付加塩も具体的な例

支持体としては、紙、パライタ紙、合成紙又は 合成樹脂フィルム等が使用できる。

この際好適に使用される有機裕謀としては、たとえばペンゼン、トルエン、キシレン、テトラヒドロフラン、アセトン、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、アクリロニトリル、メタノール、エタノール、メチルセロソルブ、酢酸エチル又はジオキサン等をあげることができる。

尚、本発明を実施するに際して用いる各模成部 分の好ましい量的割合は以下の如くである。

キサンテン化合物					1	犃
光酸化剂	0.	1	~	1	0	部
発 色 助 剤			٠			

酸		0.	1	~	1	0	塘
ポリエ	ーテル類	0.	5	~	1	0	部
バインダ	r	1		~	5	0	部
光硬化成	2.分	0.	1	~	5	0	部
定着剂	ij	0.	1	~	5	0	部

(実施例)

以下、実施例をもって本発明を説明するが、これらは本発明の範囲を限定するものではない。なお実施例中の部は特に説明のない限り重量部を表わす。また画像濃度及び非画像部濃度はマクベス反射濃度計RD-514型(ブルーフィルター)で測定した結果を示す。まず、本発明に係るキサンテン化合物の合成例を示す。

合成例1

3,6 - ジメトキシー 9 - (2 - メトキシカルポ ニル)- フェニルキサンテンの合成

3,6 - ジメトキシフルオラン 3 0 9 をメタノー

ル 2 5 0 配中に溶解し、ガス吹き込み管より塩化 水素ガスを吹きとみながら 6 0 ℃で 6 時間エステ ル化反応を行なった。反応液を水 1 と中に加え析 出物を沪別後乾燥し、 2 5 9 のエステル体を得た。

次にこのエステル体をメタノール900 mlに溶解し、水素化ホウ素ナトリウム&7 gを徐々に添加し3時間反応を行なった。得られた反応液を水2 l 中に注ぎトルエン200 mlで抽出後、溶媒を蒸発させて粗結晶を得た。これをトルエン一酢酸エチル混合液より再結晶すると115 gの3,6 ージメトキシー9 ー (2 ー メトキシカルボニル)ーフェニルキサンテンを得た。融点131~133 Cであった。また下記の分析結果より、C23 H20 Osであることを確認した。

C H

理論値 73.39 5.36

分析值 73.15 5.41

実施例1

下記【及び【の溶液を別々に調製した。 【液(発色液)

リーン製造株式会社製P-113-B)で5分間 露光すると黄色画像が得られた。その後100で で5分間定着するともはや再露光しても発色しない永久画像が得られた。画像部濃度0.80、非画 像部濃度0.05であった。

実施例 2 ~ 1 0

実施例1において 3.6 - ジメトキシ- 9 - (2 - メトキシカルボニル) - フェニルキサンテンに代え、表-1に示したキサンテン化合物を使用した以外は、実施例1と同様な操作で永久画像を得た。これらの結果も表-1に示した。

3,6 - ジメトキシー 9 - (2 - メ トキシカルボニル) -フェニルキ サンテン 0.94部 2,2'-ビス (2-クロロフェニル) - 4,4,5,5'-テトラフェニルー 1, 2'-ビイミダソール 1.65部 ドデシルベンゼンスルホン酸 3. 2 部 ポリエチレングリコール(平均分 子登1000) 2.1部 塩化ビニルー酢酸ピニルコポリマ 4.6 部 **サトラヒドロフラン** 6 2.0 部 【液 (定溶液) 1.3 - ジフェニルグアニジン 0.41部 ポリビニルアルコール 1.0部 70%エタノール 2 0 部

パーコーダを用いてコーティング紙に『液を40 タ/㎡の割合で塗布乾燥する。更にその上に『液 を30 タ/㎡の割合で塗布乾燥する。得られた感 光紙に写真オガ原版を重ね真空焼枠(大日本スク

実施例	R ₁	R ₂	Χn	Ym	ZŁ	遊り	度 非画像部	色相
2	-C2H4	- OCH 8	0	0	0	0.78	0.08	黄色
3	-сн ₂ -(Э)	- OC 2H 8	0	0	0	0,70	0. 0 9	•
4	-СН3	- OC 2H 5	-2CL (n=1)	-7CL (m=1)	0	0.75	0.07	
5	-C4H9	- OCH 8	0	0	o	0.73	0.06	•
6	-C ₂ H ₅	- N - (-)	o	0	0	0.65	0.05	•
7	-CH ₃	-CH3	0	0	0	0.65	0. 0 9	,
8	- CH 3	- N < C2H5	o	0	0	0.68	0.07	
9	- CH 3	-OCH 8	0	0	Z=CL L=4	0.71	0.09	•
10	-СН 5	- и< <u>©</u>	0	0	0	0.66	0.08	